SUBSTRATE FOR THERMAL HEAD AND PRODUCTION THEREOF

Patent number:

JP63256460

Publication date:

1988-10-24

Inventor:

NAKAMORI TOMOHIRO: others: 01

Applicant:

OKI ELECTRIC IND CO LTD

Classification:

- international:

B41J3/20

- european:

Application number:

JP19870089730 19870414

Priority number(s):

Abstract of JP63256460

PURPOSE: To enable a printing to be conducted with a low electric power in comparison with a conventional substrate and to improve heat separation between dots and reduce thermal trailing, by a method wherein a gel-form silica formed by hydrolyzing and polymerizing a metal alkoxide is used as a heat insulating layer.

CONSTITUTION: A thermal head substrate is provided with a ceramics substrate and a heat insulating layer formed on the ceramics substrate. As the aforesaid the heat insulating layer, a gel-form silica formed by hydrolyzing and polymerizing a metal alkoxide is used. A solution containing at least the metal alkoxide and water is applied to the ceramics substrate and dried. The gel-form silica is preferably used as the thermal head substrate because of its high heat resistance. The processes of the hydrolytic polymerization of an alkoxysilane are shown by formulas, and on this reaction the heat insulating layer made of the uniform gel-form silica layer can be easily formed.

$$SHOR + H_2O = HOSIGR + HOH$$
 $HOSIGR + H_2O = IOH + SIGR + HOH$
 \vdots
 $(OH) + SI - OR + H_2O = SI(OH) + ROH$
 $ISI - OR + HO - SI = ISI - O - SI + ROH$
 $ISI - OH + HO - SI = ISI - O - SI + HOH$

Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

⑩日本国特許庁(IP)

⑩ 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-256460

Mint Cl.4

識別記号

广内整理番号

匈公開 昭和63年(1988)10月24日

B 41 J 3/20

111 C-7810-2C

審査請求 未請求 発明の数 2 (全3頁)

の発明の名称

サーマルヘッド用基板およびその製造方法

願 昭62-89730 ②特

29出 願 昭62(1987) 4月14日

四発 明 者 仲 森 智博

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 沖電気工業株式会社内

億発 明 者

憩 岡 泰 治 東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 沖電気工業株式会社内

①出願人 沖電気工業株式会社 30代理人

弁理士 鈴木 敏明

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号

明

1. 発明の名称

サーマルヘッド用基板およびその製造方法

2. 特許請求の範囲

1. セラミクス基板と、

上記セラミクス基板上の保温層とを備え、

上記保温層として金属アルコキシドの加水分解、 **重合により形成したゲル状シリカを用いたことを** 特徴とするサーマルヘッド用基板。

- 2. 少なくとも金属アルコキシドと水とを含む 溶波をセラミクス基板に塗布し、乾燥させる工程 を含むことを特徴とするサーマルヘッド用基板の 製造方法。
- 3. 上記金属アルコキシドは、少なくともアル コキシシランを含む一種の金属アルコキシドある いは複数種の金属アルコキシドを混合したもので あることを特徴とする特許請求の範囲第2項記載 の方法。

- 4. 上記溶液がアルコール溶液であることを特 徴とする特許請求の範囲第2項記載の方法。
- 5. 上記溶液に塩酸、アンモニア等の、触媒を 加え、これによりアルコキシランの加水分解、重 合を促進することを特徴とする特許請求の範囲第 2項または第4項記載の方法。
- 6. 上記溶液の塗布および乾燥から成る操作を 複数回くり返すことにより所望の膜厚を得ること を特徴とする特許請求の範囲第2項記載の方法。

3. 発明の詳細な説明

〔産衆上の利用分野〕

本発明はサーマルヘッド用基板およびその製造 方法に関する。

(従来の技術)

サーマルヘッド用基板は一般的に第2図に示す ように、アルミナセラミクス基板1上に保温層2 を設けた構造を有する。従来のサーマルヘッド用 基板では、保温層2がガラスで構成されていた。

(発明が解決しようとする問題点)

これらの問題を解決するためには、発熱部に通 電した時、基板上に十分熱が蓄えられ、その後オ フにした時十分速やかに基板に熱が吸収されるサ ーマルヘッドの構造が必要となる。

この問題を解決するために、実開昭61-148640公報に開示されているごとく、多孔 質ガラスを密着した基板が考案されたが、ガラス 圏を薄くできない、製造上の困難からコスト高を 招く等の欠点があった。

この発明は以上述べた従来のサーマルヘッド用 基板の欠点を除去し、保温性に優れ、かつ熱分離 の良好なサーマルヘッド用基板を提供することを 目的とする。

(問題点を解決するための手段)

本発明のサーマルヘッド用基板は、セラミクス 基板と、上記セラミクス基板上の保温層とを備え、 上記保温層として金属アルコキシドの加水分解、 重合により形成したゲル状シリカを用いたことを 特徴とすることを特徴とする。

本発明のサーマルヘッド用基板の製造方法は、 少なくとも金属アルコキシドと水とを含む溶液を セラミクス基板に塗布し、乾燥させる工程を含む ことを特徴とすることを特徴とするものである。

上記のような保温層を有するサーマルヘッド用 基板では、少ない電力で印字が可能であり、また 同一の電力を用いれば従来に比べより薄い保温層 でよく、従ってドット間の熱分離が良好となり熱

的な尾引きが減少する。即ち、印加電力をオフしたときの温度の低下が迅速となる。

また、ゲル状シリカは耐熱性が高くサーマルへ ッド用基板に用いるのに好適である。

本発明におけるアルコキシランの加水分解重合の過程は以下に示す化学式で表わされる。

Si(OR) $_4$ +H $_2$ O \rightleftharpoons HOSi(OR) $_3$ +ROH HOSi (OR) $_3$ +H $_2$ O \rightleftharpoons (OH) $_2$ Si(OR) $_2$ +ROH

(OH) $_3$ Si $-OR+H_2$ O \rightleftharpoons Si(OH) $_4$ +ROH \equiv Si $-OR+HO-Si <math>\rightleftharpoons$ \equiv Si -O-Si +ROH \equiv Si $-OH+HO-Si <math>\rightleftharpoons$ \equiv Si -O-Si +HOH

このような反応により、本発明によれば簡易に 均質なゲル状シリカ層から成る保温層を形成する ことができる。

(実施例)

本発明の一実施例として、金鳳アルコキシドと してシリコンテトラメトキシドとシリコンテトラ エトキシドを用いて以下に述べる製造方法で基板 を作成した。

実施例1

180!のシリコンテトラメトキシド
Si(O-CH3)4を580!のメタノールで希釈し、これにpll10に調製した480!のアンモニア水を添加した。この溶液にアルミナ基板を浸透し、引きあげるディップ法によりアルミナ基板上にこの溶液を塗布した。その後80℃で10分の乾燥をおこなから成る操作を15回線り返し、膜厚20μπのシリカゲル圏をアルミナ基板上に形成した。さらにこれを110℃で乾燥し、所望の基板を得た。

実施例2

1 mol のシリコンテトラエトキシド Si(O-C₂ H₅)₄ を 1 mol のメタノールで 希釈し、これに 1 mol の水と 0.03 mol の塩酸 (HCI)を加えた。この溶液をアルミナ基板上 にスピンコート法でコーティングし、80℃で

特開昭63-256460(3)

10分の乾燥をおこなった。この塗布と、これに 続く乾燥とから成る操作を10回繰り返すことに より膜厚20μπのシリカゲル圏をアルミナ基板 上に形成した。

次に、この基板の特性を調べるため、本実施例2で示した製造方法により製造したサーマルへを形成は50xの特性を調べた。サーマルへッドの発熱体は50xの特性を調べた。サーマルへッドの発熱体は50xの気がしたが0.8ms、くり返し周期が5msのパルスで駆動した時のピーク温度と印加電力の関係を求めた。また比較試料20位で従来の20μπのガラスグレーズドアルミナ基板を用いたサーマルへッドも用意した。

第1図にその結果を示す。同図から分かるように、本発明によるサーマルヘッド用基板を用いたサーマルヘッドは同一の印加電力に対してピーク温度が高くなっている。逆にピーク温度を一定にすれば、印加電力は小さくてよい。即ち、熱効率が良好である。

好となり、熱的な尾引きが減少する。また、ゲル 状シリカは耐熱性が高くサーマルヘッド用基板に 用いるのに好適である。

さらに、本発明の製造方法によれば、簡易に均 質なゲル状シリカ層から成る保温層を得ることが できる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は印加電力とピーク温度の関係を示す線図、第2図はサーマルヘッド用基板の一般的構造を示す断面図である。

1 …アルミナ基板、 2 …保温層。

特許出願人 沖電気工業株式会社 代理人弁理士 鈴 木 敏 明

以上の2つの実施例で加えたアンモニア、塩酸は、アルコキシシランの加水分解、重合反応を促進するための放媒として加えたもので他の放媒を加えることもでき、また放媒を加えず水だけによっても、同様な基板を得ることができる。

このように本発明のサーマルヘッド用基板を用いれば、従来の基板に比べ少ない電力で印字が可能なサーマルヘッドを構成することができ、また同一の電力で印字すれば、従来に比べより薄い保温層でよく、これによってドット間の熱分離が良



